

## I. 企業概要

設立	1988年11月15日		
業種	半導体関連装置製造	資本金	1,530(百万ウォン)
主な生産品	Scrubber, Chiller	売上高 (2017年)	180,000(百万ウォン)
従業員	548名	輸出額	60,000(百万ウォン)
海外拠点 (輸出チャンネル)	該当なし		
技術導入に関する 希望形態	① 技術導入(○) ② ライセンシング( ) ③ 共同研究・開発( ) ④ 技術指導(○) ⑤ その他( )		

## II. 申請企業の技術開発現況

### ○ 当社保有技術の現状

:下記図のような処理概念を基に半導体製造過程より発生した廃ガスをScrubberで処理する。BURN,WET,PLASMA,HEATなどの工程による廃ガス処理技術を保有している。

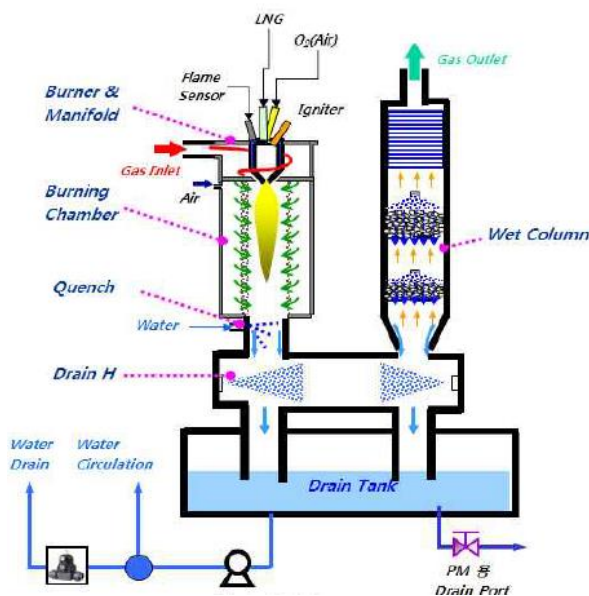


図 廃ガスの処理工程

○ 導入希望技術の技術開発現状

- 電気集塵機、Demisterを使った微細粒子(集塵)捕集技術を開発中

### Ⅲ. 導入を希望する技術内容

○ 導入希望技術名 微細粒子POWDER捕集技術

○ 技術の概念

- 半導体製造過程で発生した微細粒子の排出による維持運営費(配管、排気口などに使われる)を節減するための微細粒子低減技術

- $\text{SiH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{SiO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ のような化学反応を通して発生する微細粒子を捕集する技術  
配管の詰まり、SCRUBBER内のパウダー積滞現象などが発生し、半導体製造において設備稼働率の低減が発生

○ 導入希望技術の特長および条件

- 工程の特徴によって適用するScrubber処理方式の多様化させることでPOWDER低減させられる技術
- 300nm級の微細粒子の排出を低減させるScrubber内の捕集・排出効率を高める技術を開発
- $\text{SiO}_2$ 、 $\text{WO}_3$ 、 $\text{B}_2\text{O}_3$ など様々なPOWDER生成物質に対応できる技術

○ 技術の適用範囲

- 半導体及びディスプレイ、電子産業